(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-31848

(43)公開日 平成10年(1998)2月3日

(51) Int.Cl.⁶ 識別記号 庁内整理番号 FΙ 技術表示箇所 G11B 511 7/26 511 8940-5D G 1 1 B 7/26 B05D 1/40 B 0 5 D 1/40

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 5 頁)

(21)出願番号	特願平8-303941	(71)出願人	000004329
			日本ピクター株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)10月30日		神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番
			地
(31)優先権主張番号	特願平 8-148325	(72)発明者	近藤 哲也
(32)優先日	平 8 (1996) 5 月17日		神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番
(33)優先権主張国	日本(JP)		地 日本ピクター株式会社内
		(72)発明者	末綱 丈義
			神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番
			地 日本ピクター株式会社内

光ディスク、光ディスクの製造方法、光ディスク用プランクマスタ及び光ディスク用プランクマ (54) 【発明の名称】 スタの製造方法

スタの製造方法			
(57)【要約】	(A)	研磨	
【課題】 光ディスクのジッタが大きく、また、スタン		V	
パ製造工程時の現像の不安定さから形成ピットが流れる	(B)	保管 (保管時間: t 1)	
ことがあった。		Ψ	
【解決手段】 ガラス盤の研磨工程終了からレジスト塗 布工程開始までの時間間隔を略24時間以内にしてブラ	(c).	洗净	
ンクマスタを製造する。		Ψ	
	(D)	乾燥	
		Ψ	
	(E)	保管 (保管時間: t 2)	
		Ψ	
	(F)	密着剤被着	
		Ψ	
	(G)	レジスト塗布	
		Ψ	
	(H)	ベーキング	
		Ψ	
	(1) ブ	ランクマスタ完成	

【特許請求の範囲】

【請求項1】光ディスク用ブランクマスタの製造方法であって、少なくともガラス盤の研磨工程、洗浄工程、乾燥工程、密着剤塗布工程、レジスト塗布工程及びベーキング工程がこの順番に施され、前記ガラス盤の研磨工程が終了してから略24時間以内に前記レジスト塗布工程を行うようにしたことを特徴とする光ディスク用ブランクマスタの製造方法。

【請求項2】光ディスクの製造方法であって、少なくともガラス盤の研磨工程、洗浄工程、乾燥工程、密着剤塗 10 布工程、レジスト塗布工程、ベーキング工程からなり、前記ガラス盤の研磨工程が終了してから略24時間以内に前記レジスト塗布工程を行ったブランクマスタによって作成されたスタンパによって光ディスクを製造することを特徴とする光ディスクの製造方法。

【請求項3】請求項1記載の光ディスク用ブランクマス タの製造方法によって製造されたことを特徴とする光ディスク用ブランクマスタ。

【請求項4】請求項2記載の光ディスクの製造方法によって製造されたことを特徴とする光ディスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスクの製造 方法に係り、特に高密度記録再生される光ディスクの製 造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、光学的に読取り可能な情報が記録され、レーザ光スポットを用いて記録された情報を読み出させる光学的情報ディスクがあり、特に、近年においては、コンパクトディスク(CD)やCD-ROMをはじめとする光ディスクの普及がめざましいものとなっている。上記CD-ROMは、コンピュータ用のみならず、最近は多機能ゲーム用CD-ROMも登場し、コンピュータ、ゲーム共磁気ディスク(フロッピーディスク)やROMカートリッジからCDへの乗り換えが進んでいる。また、近年は、CDを高密度にしたDVD(デジタルビデオディスク)の商品化も検討されており、映画以外のマルチメディアへの利用も予想されている。

【0003】このように、光ディスクには色々な種類が 登場しているが、どの光ディスクであってもその製造に 際しては、情報信号のピットまたはグルーブが形成され ているスタンパを作成する工程から始まることでは共通 している。

【0004】以下、図2を用いて従来のスタンパの製造工程の例について説明する。まず、精密に研磨された円盤状ガラス基板20の表面に密着剤(図示せず)を介して、スピンコート法によってポジ型(またはネガ型)フォトレジスト21を均一に塗布し、その後ホットプレート等によりベーキングする。これをブランクマスタと呼ぶ(同図(A))。次に、記録されるべき信号により変 50

調されたレーザ光22をレンズ23により集光し、これをフォトレジスト21上に照射して所定部分を露光する(同図(B))。この露光部24のパターンは、再生専用光ディスク(CD, LD, CD-ROM、DVD等)の場合には、ピット群であり、記録再生可能な光ディスク(相変化型光ディスク、光磁気ディスク、追記型光ディスク等)の場合には、グルーブ群である。次に燐酸水素ナトリウム水溶液などのアルカリ溶液を用いて、フォトレジスト21の現像を行い、露光部24を溶解し、ピット群またはグルーブ群からなるフォトレジスト21の

2

【0005】次に、このフォトレジスト21上にスパッタリング法等により、ニッケル等の導電膜(図示せず)を形成し、更にこの導電膜を電極として、ニッケル25を所定の厚さにメッキする(同図(D))。これにより、フォトレジスト21の凹凸パターンの逆パターンが、ニッケル25に写し取られる。次にこのニッケル25をガラス基板20より剥離し、レジスト21を除去することにより、スタンパが完成する(同図(E))。そ20の後、このスタンパを用いて射出成形し、反射膜(記録膜)、保護膜等を形成することによって光ディスクが製造される。なお光ディスクは、必要に応じて貼り合わせや印刷などが施される。

凹凸パターンを得る(同図(C))。

【0006】ところで、光ディスクに記録された信号の 性能を計測するための指標のひとつに再生信号のジッタ がある。ジッタ値は再生信号のばらつきの程度を表すも ので、この数値が小さいほど高品質の光ディスクである といえる。すなわち、ジッタ値が小さい光ディスクであ れば、ドライブで使用する際のディスクの傾きや温湿度 の変化によって生じるディスクの反りに対して余裕度を 持つことになり、安定した再生を行うことができる。一 方、ジッタ値が大きい光ディスクの場合には、使用環境 の変化等によってジッタ値が更に大きくなったときに、 ピックアップによるピット分離(再生信号の分離)が困 難になり、場合によってはC1エラーが増加し、甚だし き場合には光ディスクの信号再生そのものができなくな る。DVDにおいては、ジッタ(波形等化後の信号の時 間軸方向のゆらぎをチャネルビットクロックで基準化し た値)で8%以下が必要とされている。

40 【0007】

【発明が解決しようとする課題】ところで、光ディスクの再生信号のジッタ値は、製造時に使用するスタンパによっては、大きな値になってしまうという問題点がある。すなわち、ジッタ値が大きくなってしまうスタンパとジッタ値が小さくなるスタンパとが混在しいている状態にある。これは品質管理上望ましいことではなく、ジッタ値の大きいディスクが市場に流通することは、使用環境などによって、再生できたり、できなかったりするディスクが消費者に渡ることになる。

【0008】一方、製造現場では、露光後の現像におい

3

て、少ない確率であるがレジスト膜が流れることがあることも問題となっている。ピット群が少しでも流れれば、その部分は信号の欠落となり、不良品となる。このように、光ディスクの製造において、ジッタの不安定さと現像の不安定さの二つの課題があり、これらの課題に対する対策が必要となっていた。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するための手段として、ガラス盤の研磨工程とレジスト塗布工程の間隔を略24時間以内としてブランクマスタを製造す 10る製造方法を提供しようとするものである。

[0010]

【発明の実施の形態】従来の製造方法には2つの課題があったが、本発明者らが鋭意検討した結果、これらを解決する本発明に至ったものである。すなわち、2つの不安定さの原因について製造記録を検討したところ、ブランクマスタの品質に原因があり、研磨工程日とレジスト塗布工程日との間の時間間隔が大きいとこれらの問題が生じていることが判った。そして、研磨日と塗布日とを同じ日としたときには、最も少ないジッタが安定して得られ、また現像流れが一件も発生していないことが判った。

【0011】この理由は、ガラス盤とレジスト盤との密 着力が関与していると思われる。すなわち、研磨直後の ガラスは最も活性であり、レジストに対して最も強固な 密着力を示している。そして、研磨後は時間が経つにつ れて表面活性度が落ちて行き、レジストの密着力も低下 して行くと考えられる。このため、露光によって形成さ れた均一なピットの潜像が、現像によって形を形成する 際に、密着力の弱い盤では不均一な像形成となり、ま た、甚だしく密着力が小さいときにはレジスト膜が現像 液で流れてしまうことになる。そして、不均一な像形成 となった場合には、これが再生信号のゆらぎとなって観 測されるため、ジッタ値が大幅に変動することになる。 したがって、研磨直後にレジスト塗布を行うのが望まし いが、ガラス盤の研磨工程とレジスト塗布工程の間隔を 略24時間以内にすることにより、ジッタ値の変動を小 さくすることができる。

[0012]

【実施例】以下、本発明の光ディスク用ブランクマスタの製造方法の一実施例を図1と共に説明する。図1 (A)~(I)は、本発明の光ディスク用ブランクマスタの製造方法の一実施例を説明するための工程図である。また、実施例1~9及び比較例1~7の結果を表1に示す。

4

【0013】<実施例1>

ディスクの製造方法: 図1(A)~(I)に示す。ま ず、円盤状ガラス基板を酸化セリウムを用いて精密に研 磨する(A)。続いてイソプロピルアルコール中で一時 保管した((B),保管時間t1=0.1時間)。そし て、ブラシ洗浄、超純水中の超音波洗浄によって基板を 洗浄する(C)。さらに、スピン乾燥により洗浄工程を 完成させた(D)。これをクリーンエアー中で一時保管 した((E),保管時間t2=0.1時間)。そして、 密着剤へキサメチルジシラザン (HMDS) の飽和蒸気 中に3分間放置して、密着剤を被着させた(F)。その 後、フォトレジストTSMR-V3(東京応化工業 (株))をエチルセロソルブアセテート(EСА)にて 希釈し、スピンナーを用いて 70 nmの膜厚で塗布した (G)。最後に、これを80℃でベーキングして(H) ブランクマスタ (図2(A)参照)を完成させた (I).

【0014】このブランクマスタに対して、レーザでE FM信号を最短ピット長0.254μm、トラックピッ チ0.6μmの潜像を形成した(図2(B)参照)。その後、0.2規定燐酸水素ナトリウム水溶液で現像を行って情報信号のピットを形成した(図2(C)参照)。 以降、通常の方法でスタンパを作成した。そして、同様にして、30枚のスタンパを作成し、これらのスタンパそれぞれ1枚ずつの再生専用光ディスクを作成した。なお、射出成形基板の厚みは0.6mmとし、2枚貼り合わせ構造の採用で総厚1.2mmとした。ただし、貼り合わせる基板は片面のみが情報信号のピットが形成されており、他方の基板面は鏡面無信号とした光ディスクで ある。

【0015】評価方法1:ジッタ評価は、上記方法にて作成したそれぞれの光ディスクに対して、レーザ波長413nm(Kr)、レンズNA0.6の光ヘッドを有するドライブ装置によってイコライザ通過後の信号について測定し、その平均値を求めた。

【0016】評価方法2:現像時のレジスト膜のはがれ 等は目視で検出し、光学顕微鏡によってはがれかどうか を判断し、30枚中はがれのある光ディスクの枚数を表 1に示した。

10 【0017】評価1,2の結果、30枚のスタンパから 得られた光ディスクのジッタ値の平均は6.0%であった。また、現像はがれは一切発生しなかった。

【0018】

【表1】

6

_	
_	

	レジスト溶剤	t 1	t 2	評価1(%) (30枚の平均)	評価2(n/30, n:はがれの枚数)
実施例1	ECA	0. 1	0. 1	6. 0	0/30
実施例2	ECA	4	2	6. 1	0/30
実施例3	ECA	20	0. 1	6. 5	0/30
実施例4	ECA	0. 1	20	7. 0	0/30
実施例 5	ECA	2 4	0. 1	7. 0	0/30
実施例 6	ECA	0. 1	2 4	7. 4	0/30
実施例7	ECA	0	0. 1	6. 0	0/30
実施例8	EL	0. 1	0. 1	6. 2	0/30
実施例 9	PGMEA	0. 1	0. 1	6. 0	0/30
比較例1	ECA	28	0. 1	7. 6	0/30
比較例 2	ECA	0. 1	28	8. 0	0/30
比較例3	ECA	4 2	0. 1	8. 3	0/30
比較例4	ECA	0. 1	4 2	8. 1	0/30
比較例 5	ECA	80	0. 1	9. 2	2/30
比較例6	ECA	168	0. 1	11.6	7/30
比較例?	ECA	360	0. 1	19.8	12/30

ECA:エチルセロソルブアセテート EL:乳酸エチル

PGMEA: プロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート

【0019】<実施例2~6>[保管時間t1,保管時 間t2]をそれぞれ[4,2]、[20,0.1]、 [0.1, 20], [24, 0.1], [0.1, 2]4] (時間)とし、他は実施例1と同じにして、それぞ れによって1枚ずつの再生専用光ディスクを作成した。 そして、評価方法1及び評価方法2による評価を行っ た。光ディスクのジッタ値の平均は最高でも7.4%で あり、また、保管時間 t 1, t 2の合計時間が短いほど 良好な値となっていることが判る。そして、現像はがれ は一枚も発生しなかった。

【0020】<実施例7>イソプロピルアルコール保管 することなく(保管時間t1=0)、そのまま洗浄工程 に移行させ、他は実施例1と同じにして、30枚のスタ ンパを作成し、これらのスタンパそれぞれ1枚ずつの再 生専用光ディスクを作成した。なお、保管時間t 2= 0.1である。そして、評価方法1及び評価方法2によ る評価を行った。保管時間 t 1 = 0 の場合は、保管時間 t2=0.1であれば、ガラス盤の研磨工程からレジス ト塗布工程までの時間間隔が実施例中最も短く、ジッタ 値の平均は6.0%と最も小さい値となった。また、現 像はがれも一枚も発生しなかった。

【0021】<実施例8,9>レジストを希釈する溶剤 を乳酸エチル(EL)及びプロピレングリコールモノメ チルエーテルアセテート(PGMEA)に代え、他は実*50 によって製造した光ディスクは、常にジッタが8.0%

*施例1と同じにして、30枚のスタンパを作成し、これ らのスタンパそれぞれ1枚ずつの再生専用光ディスクを 作成した。そして、評価方法1及び評価方法2による評 価を行った。レジストを希釈する溶剤を乳酸エチルやプ れ30枚のスタンパを作成し、これらのスタンパそれぞ 30 ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに代 えても評価結果は変わらず、光ディスクのジッタ値の平 均は6.2%, 6.0%で、現像はがれは発生しなかっ た。

> 【0022】<比較例1~7>[保管時間t1,保管時 間t2]をそれぞれ[28,0.1]、[0.1,2 8], [42, 0.1], [0.1, 42], [80, 0. 1], [168, 0. 1], [360, 0. 1] (時間)とし、他は実施例1と同じにして、それぞれ3 〇枚のスタンパを作成し、これらのスタンパそれぞれに よって1枚ずつの再生専用光ディスクを作成した。そし て、評価方法1及び評価方法2による評価を行った。光 ディスクのジッタ値の平均は保管時間 t 1 , t 2の合計 時間が28.1時間の場合、t2が0.1時間では7. 6%という値がでているものの、t2が28時間では 8.0%となり、必ずしも良くはない。そして、保管時 間も1, も2の合計時間が長いほどジッタ値は悪くなっ ている。また、保管時間 t 1, t 2の合計時間が80時 間を越えると現像はがれが発生し、不良と判断された。 【0023】以上、各実施例で説明したように、本発明

8

未満と小さく、現像はがれがない。また、本発明は上記 した各実施例だけに限定されるものではない。例えば、 レジストの溶剤についてはエチルセロソルブアセテート と乳酸エチル、プロピレングリコールモノメチルエーテ ルアセテート以外にもピルビン酸エチル、メチルー3-メトキシプロピオネート、メチルー3-エトキシプロピ オネート、酢酸ブチル、メチルアミルケトン、シクロへ キサノンなどでも良い。さらに、図1に示した実施例1 において、同図(B)における保管は、水などによる保 浄でも良く、同図(D)における乾燥を温純水ひきあげ 乾燥にしたり、同図(F)におけるHMDSの代わりに 他のカップリング剤を使用しても良く、上記塗布の代わ りにスピン塗布を行っても良い。また、塗布後に乾燥や 焼成を行っても良い。そして、上記各実施例では、貼り 合わせ単層ディスクを取り上げたが、両面ディスクや、 多層ディスクなどでも本発明を適用することができる。 さらに、記録再生型ディスクやパーシャルROMディス

ク、これらの組み合わせなどでも有効であることは言う までもない。

[0024]

【発明の効果】本発明の光ディスクの製造方法は、ジッタ値の小さい光ディスクと現像流れのないスタンパを提供することができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ディスク用ブランクマスタの製造方法の一実施例を説明するための工程図である。

管でも良い。そして、同図(C)における洗浄は洗剤洗 10 【図2】スタンパの製造工程を説明するための工程図で 浄でも良く、同図(D)における乾燥を温純水ひきあげ ある。

【符号の説明】

- 20 円盤状ガラス基板
- 21 ポジ型フォトレジスト
- 22 レーザ光
- 23 レンズ
- 24 露光部
- 25 ニッケル (スタンパ)

【図1】 【図2】 (A) 研磨 (A) Ψ (B) 保管 (保管時間: t 1) (C) 洗净 Ŵ (D) 乾燥 (B) Ψ (E) 保管 (保管時間: t 2) (F) 密着新被着 (C) (G) レジスト塗布 Ψ (H) ベーキング Ψ (D) (1) ブランクマスタ完成

PAT-NO: JP410031848A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10031848 A

TITLE: OPTICAL DISK, PRODUCTION OF

OPTICAL DISK, BLANK MASTER

FOR OPTICAL DISK AND

PRODUCTION OF BLANK MASTER

PUBN-DATE: February 3, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

KONDO, TETSUYA

SUETSUNA, TAKEYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

VICTOR CO OF JAPAN LTD N/A

APPL-NO: JP08303941

APPL-DATE: October 30, 1996

INT-CL (IPC): G11B007/26 , B05D001/40

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To decrease the jitter value of the reproducing signals of an optical disk by executing a glass disk polishing stage, washing stage, drying stage, adhesive applying stage, resist applying stage and baking stage in this order.

SOLUTION: A disk-shaped glass substrate is precisely polished by using cerium oxide (A). In succession, this substrate is stored temporarily in isopropyl alcohol (B) (storage time of t1=0, 1 hour). The substrate is washed by brush washing and ultrasonic washing in ultra-pure water (C). Further, the washing stage is completed by spin drying (D). The substrate is stored temporarily in clean air (E) (storage time t1=0, 1 hour). The substrate is rested for three minutes in the satd. vapor of the adhesive hexamethyl disilazane (HMDS) to adhere the adhesive.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO